

第119回講演大会 プログラム速報版

会 期：平成21年3月16日(月)～18日(水)
会 場：山梨大学 甲府キャンパス
講演要旨締切：平成21年2月7日(木)必着

3月16日(月)

A 会場

ポスターセッション概要発表

9:30 PA-01

各種溶接金属の炭化物分散状態の分析と摩耗現象

(日本工大¹, WAJ²) ○長谷川直哉¹, 松田一男¹, 福本宏昭², 伴 雅人¹

9:35 PA-02

錫皮膜の耐摩耗性向上を目的とした複合めっき

(関東学院大工¹, 関東学院大院工², 関東学院大表面工学研³, オートネットワーク研⁴)

○鈴木貴樹², 林 貴之¹, 馬場邦人², 石田卓也³, 坂 喜文⁴, 本間英夫^{1,3}

9:40 PA-03

車載用 SMD に適しためっき構造と半田組成の組合せに関する考察

(太陽化学工業) ○杉田幸子, 牧野聡朗

9:45 PA-04

エチレングリコールを溶媒に用いた電析法による熱電半導体 Zn-Sb 合金の作製

(兵庫県立大院工) ○井口涼平, 山本宏明, 森下政夫

9:50 PA-05

エチレングリコールを溶媒に用いた電析法による熱電半導体 Co-Sb 合金の作製

(兵庫県立大院工) ○水田泰弘, 山本宏明, 森下政夫

9:55 PA-06

無電解めっきの還元剤酸化反応に対するチオ尿素作用機構のエネルギー密度解析による検討

(早大先進理工) ○三重野顕, 中井浩巳, 本間敬之

10:00 PA-07

シクロデキストリンの包接挙動を用いたコレステロールの電気化学的分析

(神奈川大工¹, NIMS²) ○池澤 武¹, 金子信悟², 小早川紘一¹, 佐藤祐一¹

10:05 PA-08

耐バリア性に優れた無電解 Pd 合金皮膜の作製

(関東学院大工¹, 小島化学薬品²) ○浅沼雄貴¹, 加藤友人¹, 中島光志¹, 井上浩徳¹, 寺島 肇², 渡邊秀人², 本間英夫¹

10:10 PA-09

無電解析出反応に対する鉛添加の影響の密度汎関数法による解析

(早大先進理工) ○木下遼太, 國本雅宏, 中井浩巳, 本間敬之

10:15 PA-10

大気圧プラズマ化学液相堆積法をもちいた触媒フリー無電解金属めっきプロセスの開発

(阪大院工) ○秋山弘貴, 是津信行, 山村和也

10:20 PA-11

シリコン表面への金属置換析出に及ぼす酸化膜の影響

(兵庫県立大工¹, 兵庫県立大院工²) ○高見晃司¹, 松田貴士², 河井めぐみ², 福室直樹², 八重真治²

10:25 PA-12

ニッケルめっき浴中の不純物がニッケル皮膜へ及ぼす影響

(関東学院大院工¹, 関東学院大², 三ツ矢³) ○尾家義明^{1,3}, 山下嗣人², 若杉憲治³

10:30 PA-13

無電解めっき法による硬質金膜の作製

(関東化学中研) ○千田一敬, 岩井良太, 徳久智明, 加藤 勝

10:45 (休憩)

10:50 PA-14

陽極酸化処理を施したチタン合金板の衝突音の減衰特性

(千葉工大院工¹, 千葉工大²) ○金刺貴之¹, 高橋芳弘², 高谷松文²

10:55 PA-15

銅電析における添加剤吸着機構の走査参照電極法による解析

(関東学院大院工¹, 関東学院大工²) ○高橋夏樹¹, 本間英夫², 山下嗣人²

11:00 PA-16

ピア・スルーホール基板へのPEG誘導体を用いた電気銅めっきの検討

(関東学院大工¹, 関東学院大表面工学研²) ○和久田陽平¹, 小林正樹¹, 松原敏明¹, 中島光志¹, 杉本将治², 本間英夫¹

11:05 PA-17

電気銅めっき膜の比抵抗値に及ぼす炭素含有不純物の影響

(早大先進理工研¹, 早大理工学研²) ○山近紀行¹, 吉野正洋², 沖中 裕², 逢坂哲彌^{1,2}

11:10 PA-18

チタン陽極酸化皮膜の摩擦・摩耗特性

(千葉工大) ○服部隼也, 高谷松文

11:15 PA-19

Ti アノード酸化皮膜の新規パターニング

(近畿大理工¹, 近畿大院工², リエゾンセ³) ○八尾 佑¹, 玉川泰裕², 工藤浩棋², 島田和季², 岩崎光伸^{1,2,3}, 野間直樹¹, 堀川裕志³

11:20 PA-20

攪拌槽を用いたアルミニウムのウェットエッチング実験

(八戸高専物質¹, 東北大環境², 日本製箔³) ○松原寿恵¹, 大森恒嗣², 松本克才¹, 谷口尚司², 山本兼滋³

11:25 PA-21

マグネシウム合金 AM50 材の接着強さに及ぼす表面処理法の影響

(千葉工大院工¹, 千葉工大²) ○高井 学¹, 坂本幸弘², 高谷松文²

11:30 PA-22

シュウ酸塩を添加したアルカリ浴からのマグネシウム合金陽極酸化皮膜の皮膜硬さ

(千葉工大) ○佐久間陽介, 高谷松文

11:35 PA-23

Caustic 法によるマグネシウム合金陽極酸化皮膜の硬さに及ぼすシリカゾルの影響

(千葉工大院工¹, 千葉工大²) ○貫川美邦¹, 高谷松文²

11:40 PA-24

大気中及びガスを用いた場合のコロナ放電処理によるマグネシウム合金のぬれ性

(千葉工大院工¹, 千葉工大²) ○新村怜太¹, 高谷松文²

11:45 PA-25

ジルコニウム・セリウム複合化成処理による AZ31B マグネシウム合金の耐食性

(千葉工大院工¹, 千葉工大²) ○佐藤麻里¹, 高谷松文²

11:50 PA-26

低化成電圧におけるタンタルアノード酸化皮膜の誘電的性質

(北大院工¹, キャボットスーパーメタル²) ○小宮山正造¹, 青木芳尚¹, 泉 知夫², 幅崎浩樹¹

11:55 (休憩)

13:00 – 14:00 平成 21 年度技術賞受賞記念講演会

14:00 (休憩)

14:15 **16A-依頼講演(1)**

クルマとリサイクル

(トヨタ技術企画統括セ) 丸山慎一

15:00 16A-23 (技)

亜鉛めっき排水の分別処理による製錬原料への再資源化

(福岡工技セ) ○古賀弘毅, 小野幸徳

15:15 16A-24

磁化活性汚泥法による無電解ニッケルめっき廃液の処理の検討

(栃木産技セ¹, 桑名商事², パルシステム³, 宇都宮大⁴) ○大和弘之¹, 伊藤繁則¹, 桑名 朗², 島津義政², 鷹觜 勲², 鈴木松雄³, 安野光則³, 宮本真考³, 酒井保藏⁴

15:30 (休憩)

15:45 **16A-依頼講演(2)**

クリティカルメタルのリサイクルの現状

(東北大多元研) 中村 崇

16:30 16A-29 (技)

Evaluation of a closed-loop atmospheric evaporator for low or ambient temperature plating baths

(三進製作所) ○ONA, Erwin P, 橋本泰志, 野村記生, 佐藤 孝, 加藤 隆, 柳下幸一

16:45 16A-30

鉄酸塩溶液の電解製造と表面処理への応用

(千葉工大¹, 吉野電化工業², AIST³) ○大津英彦¹, 先崎 優¹, 榎田裕行¹, 安田和哉², 小山和也³, 山下智司¹

B 会場

ポスターセッション概要発表:

9:30 PB-01

ナフタレン雰囲気中のイオン照射により作製した DLC 薄膜の特性

(工学院大工) ○成田真一, 原田紘平, 鷹野一郎

9:35 PB-02

希ガスイオンビームアシスト法により C₁₂H₂₆ 雰囲気中で作製した DLC 薄膜の特性

(工学院大工) ○原 知之, 鷹野一郎, 原田紘平

9:40 PB-03

酸化ダイヤモンド担体が Pd 担持状態及び生成物形態に及ぼす影響

(東洋大院工¹, 東洋大先端光セ², 凸版総研³, NIMS⁴) ○青木聡亮¹, 中川清晴², 蒲生秀典³, 安藤寿浩⁴, 蒲生西谷美香^{1,2}

9:45 PB-04

酸化ダイヤモンドー繊維状ナノ炭素複合体のパターン化および電子放出特性評価

(東洋大院工¹, 凸版総研², 東洋大先端光セ³, 福岡大院工⁴, NIMS⁵) ○鍬田 稔¹, 蒲生秀典², 中川清晴³, 安徳優希⁴, 友景 肇⁴, 安藤寿浩⁵, 蒲生西谷美香^{1,3}

9:50 PB-05

金属含有 DLC 膜の高温環境下での摩擦摩耗特性の評価

(日本工大院工¹, 日本工大²) ○町田成康¹, 竹内貞雄²

9:55 PB-06

ポリマー上の DLC 成膜

(名大院工¹, 名大エコトピア²) ○白 相珉¹, 齋藤永宏¹, 高井 治^{1,2}

10:00 PB-07

モード変換型マイクロ波プラズマCVDによるダイヤモンド合成におけるO₂添加の効果

(千葉工大院工¹, 千葉工大工²) ○吉原正隆¹, 坂本幸弘², 高谷松文²

10:05 PB-08

マイクロ波プラズマ CVD による異なる炭素源からの窒化炭素合成

(千葉工大院工¹, 千葉工大工²) ○井上昌利¹, 坂本幸弘², 高谷松文²

10:10 PB-09

窒素イオン照射された PTFE 表面の撥水性評価

(工学院大工¹, 理研²) ○蔦川友佑¹, 佐々木道子², 田中啓太¹, 鷹野一朗¹

10:15 PB-10

PECVD 有機基含有シリカ膜堆積への原料分子中の炭素系官能基の影響

(名大院工¹, 名大工², 名大エコトピア³) 難波直樹¹, ○内川直和², 井上泰志³, 高井 治³

10:20 PB-11

リモート式プラズマ CVD 法による SiOCH 薄膜の微細構造制御

(名大工¹, 名大院工², 名大エコトピア³) ○内川直和¹, 難波直樹², 井上泰志³, 高井 治³

10:25 PB-12

NaCl 型窒化膜の表面エネルギーに関する第一原理計算

(岡山県立大¹, 岡山工技セ²) ○中西亮太¹, 國次真輔², 末岡浩治¹, 芝 世武¹

10:30 (休憩)

10:45 PB-13

ピルビン酸デヒドロゲナーゼ/メディエータ固定化, ポリイオン複合膜の作製とピルビン酸センサの特性評価

(茨城大工¹, AIST²) ○山口哲雄¹, 江口美佳¹, 鶴野克宏¹, 矢吹聡一²

10:50 PB-14

インクジェットにより作製した C60 微粒子の光増感性評価

(日本工大工¹, 日本工大先端技術材料セ²) ○佐々木扶紗子¹, 鈴木 学², 伴 雅人¹

10:55 PB-15

乾湿繰り返し環境下における亜鉛の犠牲防食効果と腐食生成物による防食挙動

(東理大理工¹, NIMS²) ○松崎幸一郎¹, 四反田 功¹, 板垣昌幸¹, 渡邊邦洋¹, 片山英樹², 升田博之²

11:00 PB-16

大気環境下における塗装亜鉛系めっき鋼板の端面腐食挙動

(東理大理工¹, NIMS²) ○宮原康文¹, 四反田 功¹, 板垣昌幸¹, 渡邊邦洋¹, 片山英樹², 升田博之²

11:05 PB-17

大気圧プラズマによる光触媒結晶および活性炭の表面改質

(信州大工) ○森 晶子, 手嶋勝弥, 李 先炯, 鈴木孝臣, 大石修治

11:10 PB-18

金属チタン表面への光触媒単結晶層の直接成長と新規材料の環境浄化への応用

(信州大院工¹, 信州大工², 東北大金研³) ○村越世理花¹, 手嶋勝弥², 李 先炯², 湯蓋邦夫³, 鈴木孝臣², 穴戸 統悦³, 大石修治²

11:15 PB-19

ナノコロイド溶液による Pt 担持カーボンナノチューブを用いた PEFC 触媒層の作製

(茨城大工¹, 東洋大工², NIMS³, エフシー開発⁴) ○山本 俊¹, 江口美佳¹, 鶴野克宏¹, 鋤田 稔², 青木聡亮², 蒲生美香², 安藤寿浩³, 小林芳男¹, 堤 泰行⁴

11:20 PB-20

Pt/CNB (白金ナノ粒子担持カーボンナノボール) 合成条件と触媒活性

(名大院工¹, 名大エコトピア², CREST/JST³) ○市野善道¹, 齋藤永宏^{1,3}, 高井 治^{1,2,3}

11:25 PB-21

フルクトースデヒドロゲナーゼ固定化ポリイオン複合膜による果糖センサの作製

(茨城大工¹, AIST²) ○郡司浩之¹, 江口美佳¹, 鶴野克宏¹, 矢吹聡一²

11:30 PB-22

高分子電解質ブラシの水中におけるトライボロジー特性評価

(武蔵工大工) ○木野文尋, 富田知宏, 高木研一, 藤間卓也

11:35 PB-23

高分子電解質ブラシによる超親水性表面の耐塩性

(武蔵工大工) ○富田知宏, 木野文尋, 高木研一, 藤間卓也

11:40 PB-24

1-オクタチオールを用いた固液界面接触分解法によるナノ炭素材料の合成

(東洋大工¹, 凸版総研², 東洋大先端光セ³, NIMS⁴) ○新井千晴¹, 蒲生秀典², 中川清晴³, 安藤寿浩⁴, 蒲生西谷美香^{1,3}

11:45 PB-25

自己組織化単分子膜を用いた大気圧プロセスによる紙への水性付与技術の開発

(名大工¹, 竹田印刷², AIST³, 名大院工⁴, 名大エコトピア⁵) ○鈴木和也¹, 村上達洋², 石黒義和², 山本泰望⁵, 竹内 正², 下川原厚男², 石崎貴裕³, 齋藤永宏⁴, 高井 治^{4,5}

11:50 (休憩)

13:00 – 14:00 平成 21 年度技術賞受賞記念講演会

14:00 (休憩)

14:15 **16B-依頼講演(3)**

高温アルコール中におけるアルミニウム合金の腐食 – 腐食挙動におよぼす合金組成, 溶液組成およびアノード酸化皮膜の影響

(北大院工) 菊地竜也

14:45 16B-22

ジルコニウムアノード酸化皮膜の誘電特性に及ぼす Si 添加量の影響

(北大院工) ○小山 瞬, 青木芳尚, 幅崎浩樹

15:00 16B-23

バリアー型アノード酸化アルミナ皮膜の結晶性と誘電特性

(工学院大工) ○端本 健, 阿相英孝, 小野幸子

15:15 16B-24

有機酸電解液を用いたニオブアノード酸化皮膜の誘電特性に及ぼす pH の影響

(工学院大工) ○西村和子, 阿相英孝, 小野幸子

15:30 (休憩)

15:45 16B-26

熱処理温度が Nb コンデンサの静電容量、バイアス特性および漏れ電流に及ぼす影響

(三洋電機AE研¹, 三洋電機ET研²) ○西村康一¹, 小松圭一¹, 金田和博^{1,2}, 野々上寛¹, 柴田賢一¹

16:00 16B-27

Nb コンデンサにおけるリーク電流発現機構の評価

(三洋電機AE研¹, 三洋電機ET研²) ○金田和博^{1,2}, 小松圭一¹, 西村康一¹, 野々上寛¹, 柴田賢一¹

16:15 16B-28

アノード酸化を利用した Al 薄膜の表面加工における電解液の影響

(山梨工技セ) ○勝又信行¹, 石田正文¹

16:30 16B-29

Ag ナノロッド電析 Al アノード酸化皮膜の多層膜色彩解析

(近畿大理工¹, 近畿大院工²) ○岩崎光伸^{1,2}, 宮崎 郁¹, 照屋雅和²

16:45 16B-30

Al アノード酸化皮膜中への金属硫化物の固定化

(近畿大理工) ○伊藤征司郎, 松田修平, 北川達也, 岩崎光伸

C 会場

9:30 16C-01

触媒条件による無電解めっき膜の耐食性の違い

(山梨大院医工) ○辻さやか, 柴田正実

9:45 16C-02

無電解めっき膜への添加剤の吸着挙動

(山梨大院医工) ○青柳尚之, 柴田正実

10:00 16C-03

カルボキシル基を利用した金属イオンの吸着-レーザーアブレーションしたポリイミドフィルム表面

(上村工業中研) 鈴木祥一郎

10:15 16C-04

レーザーアブレーションによる Pd 触媒除去法を用いた Ni 微細パターニング

(北大院工¹, 旭川高専², 道工試³) ○和智悠太¹, 菊地竜也¹, 坂入正敏¹, 高橋英明², 飯野 潔³, 片山直樹³

10:30 16C-05

貴金属二元系触媒を用いた化学析出酸化亜鉛薄膜の結晶配向性制御

(阪市工研¹, 日本電気²) ○小林靖之¹, 高橋久弥², 品川 勉¹, 古宇田光², 藤原 裕¹

10:45 (休憩)

11:00 16C-07

無電解 Ni-B めっきの初期析出粒子密度

(長岡技科大) ○松原 浩, 永井太一, 西山 洋, 程内和範

11:15 16C-08

無電解 NiB めっきを用いた微細電極接続における析出メカニズムの解析
(AIST) ○横島時彦, 山地泰弘, 仲川 博, 青柳昌宏

11:30 16C-09

めっき密着性および触媒吸着状態に及ぼす各種単結晶基板の影響
(山梨大院医工) ○鳥海駿介, 柴田正実

11:45 16C-10

エポキシ素地への銀ナノ粒子触媒吸着と無電解銅めっきの初期析出過程
(関西大院¹, 阪市工研², 関西大化学生命工³) ○小石川敦史¹, 藤原 裕², 小林靖之², 星山康洋³, 三宅秀和³

12:00 (休憩)

13:00 – 14:00 平成 21 年度技術賞受賞記念講演会

14:00 (休憩)

14:15 16C-20 (技)

3 価の鉄イオンを含むスズ-鉄-亜鉛 3 元合金めっき浴からの電析
(兵庫工技セ¹, 日鉱商事²) ○園田 司¹, 安藤直行², 藤平善久²

14:30 16C-21

二元系アルミニウム合金中の添加元素が亜鉛置換処理に与える影響
(岡山工技セ¹, 岡山理科大²) ○村上浩二¹, 日野 実¹, 牛尾将志², 金谷輝人²

14:45 16C-22

無電解法による Cu-MWCNT 複合めっき
(信州大工) 新井 進, ○金澤大志, 遠藤守信

15:00 16C-23

ゲル粒子を用いた部分置換スズめっき法におけるめっき条件の検討
(東理大理工) ○河野健彦, 四反田 功, 板垣昌幸, 渡邊邦洋

15:15 16C-24 (技)

樹脂めっき外観不良の要因解明
(TTDC¹, トヨタ²) ○高田智司¹, 柳本 博², 別所 毅²

15:30 16C-25

非平滑金属表面における次亜リン酸酸化反応機構の密度汎関数法による解析
(早大先進理工) ○國本雅宏, 高橋奈々, 三重野 顕, 中井浩巳, 本間敬之

15:45 (休憩)

16:00 16C-27

Fe-Pt 合金めっきに及ぼす各種条件の影響
(信州大工) 新井 進, ○加茂琢弥

16:15 16C-28

鉄族金属合金電析膜の軟磁気特性

(長崎大工¹, TDK²) ○大貝 猛¹, 高尾慶蔵¹, 水本将之¹, 香川明男¹, 田中美知², 住田成和²

16:30 16C-29

Fe系合金の組成変調膜の作製方法

(富士通) ○加藤雅也, 森山正太郎, 三宅裕子, 佐藤和昭

16:45 16C-30

アルミ金型への複合鉄系合金めっきとその機能性評価

(宇都宮大院工¹, 日本プレーテック²) ○原田 愛¹, 吉原佐知雄¹, 石川祥久², 工藤南海夫², 竹内栄一², 及川 渉²

17:00 16C-31

多孔質裏打ち電鍍法による高精度光学素子の作製

(阪大院工¹, 科学技術振興機構/さきがけ²) ○三村秀和^{1,2}, 石倉寛之¹, 松山智至¹, 佐野泰久¹, 山内和人

D 会場

9:30 16D-01

ドライプロセスを用いたカーボンナノチューブの表面機能化

(信州大工¹, 信州大工環境², 信州大工電気³) ○李 先炯¹, 手嶋勝弥², 張 仁榮³, 鄭 龍采^{*3}, 遠藤守信^{*3}, 大石修治^{*2}

9:45 **16D-依頼講演(4)**

ナノカーボンの修飾および金属等との複合構造形成

(三重大院工) 小海文夫

10:30 16D-05

カーボンナノチューブ上の細胞培養

(北大歯) ○巨理文夫, 赤坂 司, 寺田典子, 越川高光, 宇尾基弘, 北川善政

10:45 (休憩)

11:00 16D-07 (技)

超硬質薄膜材料のエタノール系潤滑に関する研究

(信州大¹, 松山技研²) ○楊 毅成¹, 野村博郎², 榎本祐嗣¹, 山辺典昭¹

11:15 16D-08

非晶質炭素膜の機械特性と熱特性に及ぼすマイクロ構造の影響

(東大院工¹, 理研²) ○宮井清一¹, 小林知洋², 寺井隆幸¹

11:30 16D-09

Ti系基材へのPBII法を用いたDLC膜の形成

(日本工大¹, KMUTT²) ○Natthapol Mueksa¹, Natthakarn Chaiyaporn², 岡田英一¹, 渡部修一¹

11:45 16D-10

PBII法により成膜したDLC膜の耐塩水性評価

(都立産技研) ○川口雅弘, 森河和雄, 渡邊禎之, 梶山哲人, 湯川泰之

12:00 (休憩)

13:00 – 14:00 平成 21 年度技術賞受賞記念講演会

14:00 (休憩)

14:15 **16D-依頼講演(5)**

真空アーク蒸着装置の開発と機能性薄膜合成

(豊橋技科大) 滝川浩史

15:00 16D-23

スクラッチ試験における DLC 膜・基材界面の応力解析

(豊田中研¹, 静岡大²) ○森 広行¹, 三井正法², 早川邦夫²

15:15 16D-24

直流プラズマ CVD 法による DLC-Si 膜の機械的特性

(豊田中研) ○松井宗久, 森 広行, 土屋能成, 五十嵐新太郎

15:30 (休憩)

15:45 16D-26 (技)

耐キャビテーションエロージョン DLC 膜の開発

(アイシン精機¹, トヨタ², アドヴィックス³, 東研サーモテック⁴) ○鈴木奉努¹, 下田健二², 金澤孝明², 七原正輝², 山本貴之², 小林和幸³, 大森直之⁴

16:00 16D-27

粗表面 DLC 膜の合成と摩擦摩耗特性の評価

(パナソニック電工生技¹, 名大工²) ○藤本真司^{1,2}, 大竹尚登², 高井 治²

16:15 **16D-依頼講演(6)**

DLC から進化した高機能膜 ICF-カーボン膜の高機能化と今後—

(ナノテック) 平塚傑工

E 会場

9:30 16E-01

クロム(Ⅲ)水酸化物皮膜形成に及ぼすコバルトイオン(Ⅱ)の影響

(九州工大院工¹, 九州工大工², 福岡工技セ³) ○小林佳弘¹, 津留 豊², 古賀弘毅³

9:45 16E-02 (技)

化成処理鋼板の白錆の定量的外観評価装置の開発

(JFEスチール¹, JFEテクノリサーチ²) ○梶山浩志¹, 藤田 栄¹, 上杉満昭²

10:00 16E-03

ステンレスの塗装後耐食性

(JFE 建材) ○浜原京子, 永石 博

10:15 16E-04 (技)

PET ラミネート鋼板のオリゴマー析出抑制技術

(JFE スチール) ○山中洋一郎, 北川淳一, 岩佐浩樹

10:30 16E-05 (技)

耐汚染性に優れたプレコート鋼板の特性とその発現機構

(日鉄住金鋼板開発) ○白垣信樹, 小菅哲嗣, 和氣亮介, 金井 洋

10:45 (休憩)

11:00 16E-07

水溶液中での金属の溶解と腐食に関する新理論の提案 (II)

(芝浦工大) ○渡辺 徹, 石野弘晃, 鈴木良治

11:15 16E-08

亜鉛めっき鋼板の大気腐食におよぼす端面露出の影響

(芝浦工大工¹, 芝浦工大院工²) 横田 歩¹, 関田和浩², ○野田和彦¹

11:30 16E-09

酸素酸イオンによる亜鉛の防食効果

(芝浦工大工¹, 芝浦工大院工², 東理大理工³) 加藤将洋¹, 関田和浩², 平野富晴², ○野田和彦¹, 板垣昌幸³

11:45 16E-10

マグネシウム合金表面処理材の海浜環境における異種金属接触腐食試験

(JWTC¹, 電化皮膜工業², 富士工業³, AIST⁴, 千葉工大工⁵) ○紺野晃弘¹, 西中一仁², 千崎 学³, 梅原博行⁴, 高谷松文⁵

12:00 (休憩)

13:00 – 14:00 平成 21 年度技術賞受賞記念講演会

14:00 (休憩)

14:15 16E-20

Mg リッチ Mg-Mg₂Ni-C 複合体の水素化・脱水素化特性

(首都大都市環境) ○平 憲一郎, 釜崎清治

14:30 16E-21

固体高分子形燃料電池における劣化挙動の評価

(芝浦工大工¹, 芝浦工大院工²) 仁熊永生¹, 石松雄也¹, 加藤慎二², ○野田和彦¹, 今井八郎¹

14:45 16E-22

燃料電池用固体高分子膜のプロトン伝導特性評価

(芝浦工大院工¹, 芝浦工大工²) 加藤慎二¹, 正平裕也¹, ○野田和彦², 今井八郎²

15:00 (休憩)

15:15 16E-24

HVOF で形成した溶射皮膜の性質に関する研究

(阪産大工) ○馬込正勝, 橋本健二, 平山一男

15:30 16E-25

蓄光溶射皮膜の輝度特性

(阪産大工) ○馬込正勝, 林 清司, 松田充生, 橋本健二, 金住順二

15:45 16E-26

Zn・Al 合金溶射粒子の生体親和性に関する研究

(阪産大工¹, エプソンイメージングデバイス²) ○筒井良樹¹, 中崎俊夫², 馬込正勝¹

16:00 16E-27

動的濡れ性制御による液滴の付着抑制技術

(AIST¹, マサチューセッツ大²) ○穂積 篤^{1,2}, T. J. McCarthy²

16:15 16E-28

ソリューションプラズマ・カルシネーションによるメソポーラスシリカの合成

(名大院工¹, CREST/JST², 名大エコトピア³) ○齋藤永宏^{1,2}, Panuphong Pootawang¹, 高井 治^{1,2,3}

16:30 16E-29

ソリューションプラズマプロセスによるFe/SiO₂コアシェルナノ粒子の合成

(名大院工¹, 名大エコトピア², CREST/JST³) ○稗田純子¹, プラテスク マリア², 齋藤永宏^{1,3}, 高井 治^{2,3}

16:45 16E-30

酸化還元能と自己支持性を有する金属酸化物-高分子コンポジットナノ膜の合成

(北大院工) ○堀口 匠¹, 青木芳尚¹, 伏見公志¹, 幅崎浩樹¹

3月17日(火)

A 会場

9:30 17A-01

光電変換機能と蓄電機能を有する複合材料の導電性ガラス上への構築

(千葉工大¹, NIMS²) ○土子和之^{1,2}, 川喜多仁², 坂本幸弘¹

9:45 **17A-依頼講演(7)**

溶射コーティングによる省エネルギー・省資源技術の現状と課題

(NIMS) 黒田聖治

10:30 (休憩)

10:45 **17A-依頼講演(8)**

高分子ゲルによる重金属の高効率回収の試み

(九大循環型社会システム工研セ) 原 一広

11:30 **17A-依頼講演(9)**

冷陰極電子衝撃形イオンソースを用いた DLC 膜の作製と除膜について

(タイゴールド) 越野修平

12:00 (休憩)

13:00 - 13:20 「第10回優秀講演賞」および「第15回学術奨励講演賞」授与式

13:20 – 13:25 会長あいさつ

13:25 – 14:25 特別講演：第70回武井記念講演会

14:25 (休憩)

14:45 **17A-依頼講演(10)**

TAB/COF テープキャリアと銅めっき応用技術

(日立電線高機能材料) 珍田 聡

15:30 17A-25

銀ナノ粒子複合ポリマーをテンプレートとする ZnO 薄膜パターンの作製

(甲南大理工¹, 新日鐵化学²) ○中道良太¹, 佐久本智子¹, 松村康史^{1,2}, 赤松謙祐¹, 縄舟秀美¹

15:45 (休憩)

16:00 **17A-依頼講演(11)**

(東北大院) 板谷謹悟

16:45 17A-30

化学合成 FePt ナノ粒子を均一充填したシリカ薄膜の作製

(早大先進理工研¹, 早大高等研², 早大ナノテク研³) ○四元孝洋¹, 石塚修吾¹, 蜂巢琢磨¹, 杉山敦史², 水野 潤³, 庄子習一¹, 逢坂哲彌¹

B 会場

9:30 17B-01

アノード酸化亜鉛光触媒の高活性化

(工学院工大工) ○小林勇太, 阿相英孝, 小野幸子

9:45 17B-02

亜鉛めっきの陽極酸化による光触媒活性の検討

(京都中小技セ) ○中村知彦, 中西貞博

10:00 17B-03

超音波処理・熱処理・陽極酸化処理したチタン線材料の過酸化水素に対する光触媒分解活性

(埼玉工大院工¹, 埼玉工大先端研²) ○桑原堅一¹, 矢嶋龍彦¹, 小山利幸², 岡部芳雄¹

10:15 17B-04

アノード酸化TiO₂ナノチューブ上への交互浸漬法による水酸アパタイト付与とViteo試験による生体親和性の評価

(工学院工大工¹, Univ.Erlangen²) ○児玉アニタ¹, Sebastian Bauer², 小松 晃¹, 阿相英孝¹, 小野幸子¹, Patrik Schmuki²

10:30 17B-05

金のアノード酸化による多孔質皮膜の形成

(首都大都市環境) ○西尾和之, 益田秀樹

10:45 (休憩)

11:00 **17B-依頼講演(12)**

陽極酸化ポーラスアルミナの光機能性デバイスへの応用

(さがみはら産業創造セ) 近藤敏彰

11:30 17B-09

電気化学プロセスによるポーラス表面の創製

(阪大院工) ○土谷博昭, 中田淳二, 藤本慎司

11:45 17B-10

材料組織をテンプレートとした高次規則化ポーラス層創製の試み

(阪大院工) ○土谷博昭, 赤木俊文, 杉原敦史, 小泉雄一郎, 南埜直俊, 藤本慎司

12:00 (休憩)

13:00 – 13:20 「第 10 回優秀講演賞」および「第 15 回学術奨励講演賞」授与式

13:20 – 13:25 会長あいさつ

13:25 – 14:25 特別講演：第 70 回武井記念講演会

14:25 (休憩)

14:45 **17B-依頼講演(13)**

多孔質シリコンを電極とした金属電析反応

(京大エネ理工研) 深見一弘

15:15 17B-24

異なる孔径をもつルゲート型多孔質シリコン多層膜の作製と光学特性

(京大エネ理工研¹, U.C. San Diego²) M.S.M. Salem¹, M.J. Sailor², 深見一弘¹, 作花哲夫¹, ○尾形幸生¹

15:30 17B-25

p 型 Si の陽極化成時における光照射効果

(成蹊大理工) ○大木早苗¹, 新井 完¹, 栗又尚子¹, 並木 大¹, 中野武雄¹, 馬場 茂¹

15:45 (休憩)

16:00 **17B-依頼講演(14)**

高分子表面の構造制御と接着・剥離

(神戸大院工) 西野 孝

16:45 17B-30

高周波回路用ハル素樹脂基板の表面改質

(兵庫工技セ¹, 阪大院工大院工²) ○柴原正文¹, 山村和也², 是津信行², 岸本 正¹

C 会場

9:30 17C-01

Cu-MWCNT 複合めっきの電界放出特性

(信州大工) 新井 進, ○品田絵理, 遠藤守信

9:45 17C-02

CNT を含有した機能性複合 Ni めっき被膜の開発 (第6報) —熱処理による被膜硬さの変化—
(山形工技セ) ○鈴木庸久, 加藤睦人, 松田 丈, 小林誠也, 丹野裕司

10:00 17C-03

Co-MWCNT 複合めっき

(信州大工) 新井 進, ○宮川和明, 遠藤守信

10:15 17C-04

銅/グラファイト複合めっき被膜の作製と摩耗特性の評価

(岡山大院自然科学) 榎村 茂, ○林 秀考, 岸本 昭

10:30 (休憩)

10:45 17C-06

ジメチルスルホン系電気アルミニウムめっき膜の高純度化

(日立金属工研) ○星 裕之, 岡本篤志, 安藤節夫

11:00 17C-07 (技)

ジメチルスルホン系めっき浴から電析したアルミニウム膜の物性評価

(日立金属工研) ○星 裕之, 岡本篤志, 安藤節夫

11:15 17C-08

低温塩化物溶融塩中からの軟鋼上への Al-Mn-Zn 合金めっき

(北大院工) ○金子翔太, 上田幹人, 大塚俊明

11:30 17C-09

EMIC-AlCl₃からのMg合金上へのAlめっき

(北大院工) ○田部井康, 上田幹人, 大塚俊明

11:45 17C-10

イオン液体中での還元拡散法による Cu-Zn 合金形成

(京大院工) ○築瀬功造, 伊藤 輝, 邑瀬邦明, 一井 崇, 杉村博之

12:00 (休憩)

13:00 – 13:20 「第 10 回優秀講演賞」および「第 15 回学術奨励講演賞」授与式
13:20 – 13:25 会長あいさつ
13:25 – 14:25 特別講演：第 70 回武井記念講演会

14:25 (休憩)

14:45 17C-22

非晶質 Au-Co 系合金めっきの作製と物性評価

(早大理工¹, 早大先進理工研², 関東化学中央研³, 早大理工学研⁴) ○井上隆裕¹, 山近紀行², 吉野正洋⁴, 千田一敬³, 加藤 勝³, 沖中 裕⁴, 逢坂哲彌^{1,2,4}

15:00 17C-23

微細結晶—非晶質混在合金めっき

(関東化学中央研¹, 早大先進理工研², 早大理工学研³) ○千田一敬¹, 岩井良太¹, 徳久智明¹, 加藤 勝¹, 山近紀行², 沖中 裕³, 逢坂哲彌^{2,3}

15:15 17C-24

酸性水溶液における Bi-Sb-Te 系熱電半導体膜の電解析出

(名大工¹, 名大院工²) ○山本浩太¹, 平林義崇², 市野良一², 興戸正純²

15:30 17C-25

水溶液中におけるセリウム酸化物皮膜の電析

(名大院工) ○神山拓哉, 市野良一, 興戸正純

15:45 (休憩)

16:00 17C-27

クロムめっきの密着性に及ぼす試験温度の影響

(武蔵工大¹, 千代田第一工業²) 白木尚人¹, 関 宏友¹, ○武内正之¹, 浜村尚樹¹, 鈴木信夫², 新国哲也²

16:15 17C-28

三価クロム浴による硬質クロムめっき浴プロセスの改良

(武蔵工大院工¹, 武蔵工大²) ○橋本岳宗¹, 眞保良吉², 星野重夫², 佐藤秀明², 二ノ宮進一²

16:30 17C-29 (技)

クロムめっき皮膜に対する 6 価フリー防錆処理の効果

(奥野製薬) ○永峯伸吾, 中村 要, 片山順一

16:45 17C-30

パルス電解法による Zn-Ni 合金めっき

(名市工研) ○三宅猛司, 加藤雅章, 松本宏紀, 高橋紘次

D 会場

9:30 17D-01

マイクロ波プラズマ CVD による低基板温度での窒化炭素合成

(千葉工大工) ○萩原正悟, 坂本幸弘, 高谷松文

9:45 17D-02

RF スパッタリングによるマグネシウム基板への炭素系薄膜の作製

(千葉工大¹, 千葉工大院工²) ○坂本幸弘¹, 小林厚輝¹, 高井 学², 村井勇太¹, 高谷松文¹

10:00 17D-03

熱フィラメント CVD による B ドープダイヤモンド合成における基板設置の影響

(千葉工大工) ○李 崇基, 坂本幸弘, 高谷松文

10:15 17D-04

マイクロ波プラズマ CVD による CVD ダイヤモンド基板への B ドープダイヤモンドの作製

(千葉工大工) ○柴野悠基, 坂本幸弘, 高谷松文

10:30 (休憩)

10:45 17D-06

ボロンドープダイヤモンド膜の破壊強度特性評価

(日本工大¹, 日本工大院工²) ○竹内貞雄¹, 村石貴志², 鈴木 航²

11:00 **17D-依頼講演(15)**

デバイスを目指したダイヤモンドの研究状況

(AISTダイヤモンド研) 鹿田真一

11:45 17D-10

ダイヤモンド電極の水溶液中のエタノールアミンへの応答特性

(静大工) ○細井太郎, 前田康久

12:00 (休憩)

13:00 – 13:20 「第10回優秀講演賞」および「第15回学術奨励講演賞」授与式

13:20 – 13:25 会長あいさつ

13:25 – 14:25 特別講演：第70回武井記念講演会

14:25 (休憩)

14:45 17D-22

強ひずみ加工 ECAP を施した Al-Cu 合金の耐孔食性

(九大工¹, 九産大工²) ○孫 仁俊¹, 大上 悟¹, 中野博昭¹, 福島久哲¹, 小林繁夫²

15:00 17D-23

多チャンネル電極測定法を用いた閉塞空間内の鉄腐食挙動および物質移動の空間形状依存性

(北大院工) ○長沼 淳, 安住和久

15:15 17D-24

純銅板表面に生成する酸化物および硫化物のカソード還元法による評価

(室工大機械) ○境 昌宏, 山下晃弘

15:30 17D-25

漏水検知システム用純銅電極の耐食性評価

(芝浦工大院工¹, 芝浦工大工²) ○姉齒浩平¹, 今井八郎²

15:45 17D-26 (技)

クロムフリー黒色無機顔料の開発

(奥野製薬) ○加東 隆, 蔭久輝彦, 産一盛裕

16:00 17D-27

ポリピロールの電解酸化重合における成長過程の解明

(千葉工大¹, NIMS²) ○野崎哲秀^{1,2}, 川喜多 仁², 黒田聖治², 坂本幸弘¹

16:15 17D-28

水熱合成法によるマグネシウム合金表面へのナノシート構造の作成

(AIST) 石崎貴裕

16:30 17D-29

マイクロコンタクトプリンティングを利用したポリイミド前駆体上への位置選択的ダイレクトメタライゼーション

(甲南大理工¹, 新日鐵化学²) ○松村康史^{1,2}, 榎本 靖², 赤松謙祐¹, 縄舟秀美¹

16:45 17D-30

Sn めっき皮膜へのレーザー照射とその効果

(岡山工技セ¹, オーエム産業²)○日野 実¹, 水戸岡豊¹, 村上浩二¹, 高見沢政男², 西村宣幸²

3月18日(水)

A 会場

9:30 **18A-依頼講演(16)**

超臨界流体中有機金属還元法による薄膜堆積

(山梨大院医工学) 近藤英一

10:15 18A-04

Siナノホールの作製と超臨界CO₂によるCu埋め込み

(山梨大院医工学¹, 阪大院工²) ○玉井 架¹, 松原正弘¹, 李 佳龍², 松村道雄², 近藤英一¹

10:30 18A-05

超臨界流体を用いたカーボンナノ構造体表面上への金属ナノ粒子の形成

(名城大理工¹, 名大院工²) ○平松美根男¹, 堀 勝²

10:45 (休憩)

11:00 18A-07

超臨界二酸化炭素中の酸化チタンの成膜条件とカバレッジ

(東海大院工¹, 東海大工²) ○秋山泰伸¹, 奥村優夢¹, 高橋健太², 兼岡俊輔²

11:15 18A-08

超臨界二酸化炭素流体中における酸化チタン薄膜の化学的堆積

(上智大理工¹, 中央大理工²) ○内田 寛¹, 加納富由樹¹, 助川太一¹, 由井和子², 幸田清一郎¹

11:30 18A-09

超臨界アニールによるめっき銅膜の粒成長

(芝浦工大理工¹, KISCO²) ○島田裕至¹, 上野和良¹, 蓬田 茂², 矢田隆司², 橋本亜紀子²

11:45 18A-10

微小レジスト構造物-基板間の接合強度に及ぼす超臨界二酸化炭素洗浄の影響

(東工大精研) ○石山千恵美, 柴田暁伸, 曾根正人, 肥後矢吉

12:00 (休憩)

13:00 - 13:45 平成 21 年度協会賞受賞記念講演会

14:00 - 14:30 平成 21 年度論文賞受賞記念講演会

14:30 (休憩)

14:45 **18A-依頼講演(17)**

超臨界CO₂を利用しためっき技術

(東工大精密工研) 曾根正人

15:30 18A-25

超臨界二酸化炭素を用いた溶体急速膨張法による有機半導体材料の薄膜創製

(信州大工¹, 東大院工²) ○内田博久¹, 山本 大¹, 出浦桃子², 杉山正和²

15:45 18A-26

超臨界二酸化炭素を用いた溶体急速膨張法によるアントラセン薄膜の創製メカニズムの解明

(信州大工¹, 東大院工²) ○内田博久¹, 山本 大¹, 杉山正和²

16:00 18A-27

超臨界 CO₂ を用いた 3 次元 MEMS 構造への金属・酸化膜, 有機膜の高均一コーティング

(経産省BEANS¹, 東大院工²) ○杉山正和^{1,2}, 百瀬 健¹, 山田英雄¹, 霜垣幸浩^{1,2}

B 会場

9:30 18B-01

酸素選択的透過膜を搭載した酵素センサの開発

(兵庫県立大院工物質理) ○安川智之, 前川英治, 水谷文雄

9:45 **18B-依頼講演(18)**

MPC ポリマーによる高生体親和性表面インターフェース

(東大院工) 高井まどか

10:30 18B-05

酸化イリジウム系混合酸化物触媒上におけるH₂O₂検出特性

(同志社大理工) ○盛満正嗣, 岡崎 礼

10:45 18B-06

ポリスチレン@金コアシェルナノ粒子アレイの作製と近赤外応答局在表面プラズモンセンサーの開発

(阪大院工) ○是津信行, 秋山弘貴, 山村和也

10:45 (休憩)

11:00 18B-07

シクロオレフィンポリマー基材のVUV光化学表面変換に及ぼす処理雰囲気の影響

(京大院工¹, アルプス電気²) ○金 永鍾¹, 杉村博之¹, 邑瀬邦明¹, 谷口義尚², 田口好弘²

11:15 **18B-依頼講演(19)**

濃厚ポリマーブラシによる低摩擦表面

(京大化学研) 辻井敬巨

12:00 (休憩)

13:00 - 13:45 平成 21 年度協会賞受賞記念講演会
14:00 - 14:30 平成 21 年度論文賞受賞記念講演会

14:30 (休憩)

14:45 **18B-依頼講演(20)**

高密度高分子ブラシによる表面エンジニアリング

(筑波大院数理物質科学) 長崎幸夫

15:30 18B-25

分子認識能を有するポリエチレングリコール修飾表面の構築法

(筑波大院数理物質¹, 筑波大TIMS², 筑波大TARA³, 筑波大院人間総合⁴, 筑波大MANA⁵)

○吉本敬太郎^{1,2,3}, 長崎幸夫^{1,2,3}

15:45 18B-26

ポリエチレングリコール-ポリアミン共重合体固定化金表面を用いたDNAセンシンググラフト共重合体およびブロック共重合体修飾表面の構造解析と機能評価

(筑波大院数理物質¹, 筑波大TIMS², 筑波大TARA³, 筑波大院人間総合⁴, 国際農林水産業研究セ⁵)

○松本慎哉¹, 吉本敬太郎^{1,2,3}, 野澤麻希子¹, 越後拓也⁵, 根本清子⁵, 八田珠郎⁵, 長崎幸夫^{1,2,3}

C 会場

9:30 18C-01 (技)

ピアフィリング硫酸銅めっき添加剤の電気化学的分析

(KAST¹, 神奈川県産技C², 関東学院大工³) ○西谷伴子¹, 川口明廣², 本間英夫³

9:45 18C-02 (技)

ピアフィリング硫酸銅めっき用添加剤の簡易分析方法の検討

(荏原ユーザライト総研) ○石川久美子¹, 丸山恵美¹, 高谷康子¹, 坂川信夫¹, 君塚良一¹

10:00 18C-03

電気銅めっき皮膜の物性に影響を及ぼす添加剤の作用機構の解析

(宇都宮大院工¹, 三井金属総研²) ○松田光由^{1,2}, 高橋拓也¹, 吉原佐知雄¹, 土橋 誠²

10:15 18C-04

自己組織化膜のマイクロコンタクトプリンティングを利用した新規銅電析プロセス

(甲南大理工) ○中嶋勝之, 赤松謙祐, 縄舟秀美

10:30 18C-05

改良型 SF-MDC によるマイクロ Cu ロッドの作製

(北大院工) ○後藤良仁, 坂入正敏, 菊地竜也, 伏見公志

10:45 (休憩)

11:00 18C-07

電解銅めっきによるドックボーン状薄膜試験片の作製とその機械的性質

(秋田大工学資源¹, 秋田大院工², 秋田大³) ○多田英司¹, 武者岳³, 大口健一¹, 三浦裕太², 羽手原健³

11:15 18C-08 (技)

電解銅箔における異常析出発生機構の微小電極を用いた解析

(東理大理工¹, 日本電解²) ○小野智人¹, 渡邊邦洋¹, 板垣昌幸¹, 四反田功¹, 山口智寛²

11:30 18C-09

強磁場中での銅電析におけるマイクロ MHD 効果

(埼玉産技セ¹, 早大高等研², 職業大³, 東北大金研⁴, NIMS⁵) ○森本良一¹, 杉山敦史², 青柿良一³, 茂木 巖⁴, 山内悠輔⁵

11:45 18C-10 (技)

硫酸浴からの環境調和型スペキュラム合金の電析

(大和化成¹, 京都産技研工技セ², メテック北村³, 甲南大理工⁴) ○河口桂子¹, 北村慎悟¹, 中村俊博², 水谷 泰², 鹿子木俊朗³, 池田真二³, 中井庸司³, 縄舟秀美⁴

12:00 18C-11

めっきにおけるエア-攪拌の流体解析

(上村工業中研) ○佟 立柱¹, 小原勝彦¹, 浅富士夫¹, 杉浦 裕¹

12:15 (休憩)

13:00 - 13:45 平成 21 年度協会賞受賞記念講演会

14:00 - 14:30 平成 21 年度論文賞受賞記念講演会

14:30 (休憩)

14:45 18C-22

金めっきにおけるタリウムへの働きに関する考察

(九州工大工) 津留 豊

15:00 18C-23 (技)

ノンシアン金めっき膜中のタリウム共析挙動の解析

(N.E.ケムキャット¹, 早大ナノテク研², 早大理工³) ○井上晃一郎¹, 中村裕樹¹, 齋藤美紀子², 本間敬之³

15:15 18C-24

非シアン浴からの金-カーボンブラック複合めっき

(信州大工) 新井 進, ○山田直樹, 鈴木陽介, 遠藤守信

15:30 18C-25

ホウ酸フリー型スルファミン酸 Ni 浴によるコンポジットめっき

(関東学院大¹, 関東学院大表面工学研²) ○中丸弥一郎¹, 和久田陽平¹, 田代雄彦², 本間英夫¹

15:45 (休憩)

15:45 18C-26

ウィスカ発生に及ぼすスズめっき時水素発生および皮膜組織の影響

(九州工大院工¹, 九州工大工²) ○上森 圭¹, 津留 豊², 患良秀則¹

16:00 18C-27 (技)

照合電極を電位センサーに応用しためっき電流密度のリアルタイム測定

(九州工大工¹, 山本鍍金試験器²) ○津留 豊¹, 岡本孝三¹, 細川知則¹, 山本 渡², 小山田仁子²

D 会場

9:30 18D-01

イオン，UV 除去プラズマによるフォトレジスト微細化

(山梨大院医工¹，東京エレクトロンAT²) ○為国孝洋¹，柴田正実¹，西村栄一²

9:45 18D-02

光触媒 Nb 系ナノシートのポリマー表面改質への応用

(信州大院工¹，信州大工²) ○鈴木清香¹，手嶋勝弥²，李 先炯²，鈴木孝臣²，大石修治²

10:00 18D-03

第一原理計算による Cr 系材料の表面エネルギー算出

(岡山工技セ¹，岡山県立大²) ○國次真輔¹，中西亮太²，末岡浩治²

10:15 18D-04

固体原料を用いた大気圧マイクロプラズマによる Ti 系硬質被膜の形成 (第 1 報)

—金属ワイヤ原料の表面性状の変化—

(山形工技セ¹，AIST²) ○鈴木庸久¹，清水禎樹²

10:30 18D-05

大気圧マイクロプラズマ MOCVD による Ti 系硬質被膜の形成 (第 1 報) —チタンテトライソプロポキシドを原料とする検討—

(山形工技セ¹，AIST²) 鈴木庸久¹，清水禎樹²，○加藤睦人¹，三井俊明¹

10:45 (休憩)

11:00 18D-07

PSII 法を用いた炭素イオン注入による金属炭化物形成

(長崎工技セ¹，ダルムシュタット工大²) ○馬場恒明¹，畑田留理子²，S. Flege²，W. Ensinger²，R. Ugas²，M. Yekehtaz²

11:15 18D-08

反応性スパッタリングによる CVD ダイヤモンド基板上への窒化ホウ素膜の作製

(千葉工大) ○坂本幸弘，小林厚輝，高谷松文

11:30 18D-09

反応性スパッタリングによる非晶質窒化ホウ素膜の作製

(千葉工大) ○小林厚輝，坂本幸弘，高谷松文

11:45 18D-10

DC スパッタリングによる Si 系薄膜の作製

(千葉工大) ○菅谷和真，坂本幸弘，高谷松文

12:00 (休憩)

13:00 – 13:45 平成 21 年度協会賞受賞記念講演会

14:00 – 14:30 平成 21 年度論文賞受賞記念講演会
